

2011年6月22日

FEI Company 製 FIB/SEM 装置の差止仮処分決定について

株式会社日立ハイテクノロジーズ(執行役社長:久田 眞佐男/以下、日立ハイテック)は、米国FEI Company製 FIB/SEM装置*が、日立ハイテックの集束イオンビームを利用したマイクロサンプリング技術に関連する特許権(特許第2774884号)を侵害しているとして、日本FEIを相手方として東京地方裁判所に差止仮処分申立(2010年12月15日)を行ない、2011年6月15日、侵害との主張が認められ、下記製品を製造し、販売し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡若しくは貸渡しのための展示をし、又は輸入をしてはならない、との仮処分決定が下されました。

[対象製品] Quanta 3D FEG

オムニプローブまたはオートプローブ、及びプラチナ・デポジションガス、タングステン・デポジションガス
またはカーボン・デポジションガスのいずれかのガス源が搭載された GIS 装置*を備えたもの

なお、この特許権については、下記製品に対する輸入差止申立も、既に、東京税関により受理決定されています。

[対象製品] 1: Helios NanoLab 450S

2: Quanta 3D 200i

3: Quanta 3D FEG 600

いずれもオムニプローブ及び GIS 装置を備えたもの

日立ハイテックは、知的財産権を極めて重要な経営資源と位置付けており、今後とも日立ハイテックの知的財産権が侵害されたと判断した場合には、毅然とした態度で臨んでいく所存です。

(ご参考)

*FIB/SEM 装置 : 走査電子顕微鏡(Scanning Electron Microscope)を有する集束イオンビーム(Focused Ion Beam)装置

*GIS 装置 : ガスインジェクションシステム(Gas Injection System)装置

【報道関係問い合わせ先】

CSR 本部 コーポレート・コミュニケーション部 担当:松本、武内

TEL:03-3504-3258